

한국과학기술원 NCS 기반 직무기술서 – 위촉연구원

채용분야	위촉연구원	분류체계	대분류	중분류	소분류	세분류
			19. 전기*전자	03. 전자기기 개발	01. 반도체 개발	01. 반도체 개발 02. 반도체 제조 03. 반도체 장비
설립이념	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국과학기술원법 - 깊이 있는 이론과 실제적인 응용력으로 국가 산업 발전에 기여할 고급 과학기술 인재 양성 - 국가 정책으로 추진하는 중장기 연구 개발과 국가 과학기술 저력 배양을 위한 기초응용 연구 수행 - 각 분야 연구 기관 및 산업계와 연계한 연구 지원 					
KAIST 주요사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ Education: 창의적 인재 육성, 융합교육 강화, 글로벌 과학기술 리더 양성, 교육인적 역량 강화 ○ Research: 우수 연구 과제 발굴 지원, 특성화된 연구인력 확보, 창업문화 선진화, 고부가가치 지적재산권 창출 및 기술이전/사업화 촉진, 선도적 대형과제 발굴 ○ Cooperation: 국제적 수준의 근무 환경 조성, 글로벌 리더십을 위한 다양한 협력 ○ Administration: 외국인 학생·교원 대상 행정·기술 서비스 제공(Bi-lingual Campus 운영 지원) 					
성장 동력	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vision: 글로벌 가치창출 세계 선도대학(Global Value-Creative World-Leading University) <ul style="list-style-type: none"> - 지식창조형 글로벌 융합인재 양성 허브 (Hub for Fostering Knowledge Creation and Global Convergence Talents) - 세계적 신지식 신기술 창출 진원지(Center for the World-Leading New Knowledge and Technology) ○ 5대 혁신: 교육혁신, 연구혁신, 기술사업화혁신, 국제화혁신, 미래전략혁신 ○ 3C Leadership: Change(변화), Communication(소통), Care(돌봄) 					
담당 업무	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공정 개발 및 장비 개발 엔지니어 					
직무수행 내용	<ul style="list-style-type: none"> ○ Monolithic 3D integration process baseline set up ○ Baseline set up 후의 주기적인 공정관리 및 소자 특성 평가 ○ CMOS 공정 장비 maintenance 및 장비 개조 					
필요지식	<ul style="list-style-type: none"> ○ CMOS process integration ○ ALD equipment design and modification 					
필요기술	<ul style="list-style-type: none"> ○ CMOS fab 회사의 fab line 에서의 unit process 및 process integration 개발 경력 ○ ALD equipment, thin film deposition equipment 개발 경력 					
직무수행태도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 연구개발에 대한 열정 ○ 공동연구 할 수 있는 친화력 					
직업기초능력	<ul style="list-style-type: none"> ○ CMOS fab 안에서 일할 수 있는 안전 관련 지식 ○ CMOS fab 일괄공정 진행에 필요한 장비 관련 지식 					
참고사이트	https://www.ncs.go.kr/index.do					